PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

43

(11)Publication number:

10-079345

(43)Date of publication of application: 24.03.1998

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number: 08-255505

(71)Applicant:

NIKON CORP

(22)Date of filing:

04.09.1996

(72)Inventor:

KUDO SHINTARO

SUENAGA YUTAKA

(54) PROJECTION OPTICAL SYSTEM AND EXPOSING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to correct the sum of aberration and Petzval by a method wherein the first lens group to the sixth lens group are arranged from the side of an object, and a specific condition is satisfied.

SOLUTION: The first and the second lens groups of positive power, the third lens group of negative power, the fourth lens group of positive power, the fifth lens group of $|E_i| > |L/B|$ of negative power and the sixth lens group of positive power are formed in the order from the side of an object. By satisfying the condition of formulas I to Vq, the first lens group suppresses the generation of higher aberration, the second lens group corrects distortion, and the third lens group corrects the sum of Petzval. The L in. the formula indicates the distance from the first object to the second object, En indicates the distance from the top point of the lens surface on the side of the first object to the pupil of incidence, Ex indicates the distance from the top point of the lens surface of the second object side to the pupil of incidence, β indicates magnification of projection, 0. $0.4 < |f_3/L| < 0.06$ f1, f3, f4, f5 and f6 indicate the distance of focal point of the first, third, fourth, fifth and sixth lens groups, bf1. indicates the distance from the top point of the surface on the side of the fast lens group to the back side focal point.

 $E \cdot | > L$

1. $0 \le 5 f_1 / f_1 \le 1$. 5

0. $0.4 < 1.6 \times 1.1 < 0.06$

 $0.6 \le f_6 \times f_4 \le 1.3$

П

ì

W

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-79345

(43)公開日 平成10年(1998) 3月24日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L 21/027			H 0 1 L 21/30	5 1 5 D
G03F 7/20	5 2 1		G03F 7/20	5 2 1
			H 0 1 L 21/30	5 1 6 A

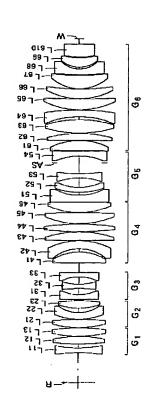
式会社ニコン内 (72)発明者 末永 豊				
株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 工藤 慎太郎 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 (72)発明者 末永 豊 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内		·	審査請求	未請求 請求項の数8 FD (全 16 頁)
(72)発明者 工藤 慎太郎 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 (72)発明者 末永 豊 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内	(21)出願番号	特願平8-255505	(71)出願人	
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内 (72)発明者 末永 豊 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内	(22)出願日	平成8年(1996)9月4日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
式会社ニコン内 (72)発明者 末永 豊 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株 式会社ニコン内			(72)発明者	工藤(慎太郎
(72)発明者 末永 豊 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内				東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内				式会社ニコン内
式会社ニコン内			(72)発明者	末永 豊
				東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
(74)代理人 弁理士 猪熊 克彦				式会社ニコン内
			(74)代理人	弁理士 猪熊 克彦

(54) 【発明の名称】 投影光学系及び露光装置

(57)【要約】

【課題】入射瞳と射出瞳をほぼ無限遠に位置させるいわゆる両側テレセントリックな光学系としながらも、広い露光範囲での像面平坦性を確保するためのベッツバール和の補正と、微細なパターンを高解像に転写するための大きいNAの光束に対する諸収差の良好な補正との両立を実現させることのできる高性能な投影光学系を提供する。

【解決手段】第1物体Rの像を第2物体W上に投影する投影光学系PLにおいて、第1物体R側から順に、正のパワーの第1レンズ群 G_1 と、正のパワーの第2レンズ群 G_2 と、負のパワーの第3レンズ群 G_3 と、正のパワーの第4レンズ群 G_4 と、負のパワーの第5レンズ群 G_5 と、正のパワーの第6レンズ群 G_6 とを有し、且つ所要の条件を満足することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1物体の像を第2物体上に投影する投影 光学系において、

前記第1物体側から順に、正のパワーの第1レンズ群 と、正のパワーの第2レンズ群と、負のパワーの第3レ ンズ群と、正のパワーの第4レンズ群と、負のパワーの 第5レンズ群と、正のパワーの第6レンズ群とを有し、 且つ以下の各条件を満足することを特徴とする投影光学 系。

$$|E_{n}| > L$$
 (1)

$$|E_{x}| > |L/\beta|$$
 (2)
1. $0 < b f_{1}/f_{1} < 1$. 5 (3)
0. $0 < 4 < |f_{3}/L| < 0$. 06 (4)
0. $0 < 4 < |f_{5}/L| < 0$. 06 (5)
0. $6 < f_{6}/f_{4} < 1$. 3 (6)

但し、L:前記第1物体から第2物体までの距離

E_n:最も第1物体側のレンズ面の頂点から入射瞳まで

$$-0.5 < (\Sigma P_1 + \Sigma P_2) / \Sigma P_3 < -0.2$$

但し、 ΣP_1 : 前記第1レンズ群のペッツバール和

ΣΡ₂:前記第2レンズ群のペッツバール和

ΣΡ₃:前記第3レンズ群のペッツバール和 である。

【請求項4】以下の条件を満足する、請求項1、2又は 3記載の投影光学系。

0. $1.4 < f_2/L < 0.25$

但し、 f_2 : 前記第2レンズ群の焦点距離である。

【請求項5】前記第3レンズ群と前記第5レンズ群とに 属する各レンズの各レンズ面のパワーをめとするとき、 何れのレンズ面についても以下の条件を満足する、請求 項1、2、3又は4記載の投影光学系。

 $|\phi \cdot L| < 6.7 \tag{9}$

【請求項6】 | *β* | < 1 である、請求項1、2、3、4 又は5記載の投影光学系。

【請求項7】前記第6レンズ群は正のパワーのレンズを 6枚以上有する、請求項1、2、3、4、5又は6記載 の投影光学系。

【請求項8】照明光学装置によってレチクルを照明し、 該レチクル上のパターンを投影光学系によってウエハ上 に転写する露光装置において、

前記投影光学系は前記レチクル側から順に、正のパワー の第1レンズ群と、正のパワーの第2レンズ群と、負の パワーの第3レンズ群と、正のパワーの第4レンズ群 と、負のパワーの第5レンズ群と、正のパワーの第6レ ンズ群とを有し、且つ以下の各条件を満足することを特 徴とする露光装置。

$$|E_n| > L$$
 (1)

$$|E_x| > |L/\beta|$$
 (2)
1. $0 < b f_1/f_1 < 1$. 5 (3)
0. $0 < 4 < |f_3/L| < 0$. 06 (4)
0. $0 < 4 < |f_5/L| < 0$. 06 (5)

の距離

E、: 最も第2物体側のレンズ面の頂点から射出瞳まで の距離

β:投影光学系の投影倍率

f₁: 前記第1レンズ群の焦点距離

bf₁:前記第1レンズ群の最も第2物体側のレンズ面 の頂点から第1レンズ群の後側焦点までの距離

f₃:前記第3レンズ群の焦点距離

f₄:前記第4レンズ群の焦点距離

f₅:前記第5レンズ群の焦点距離

f₆:前記第6レンズ群の焦点距離 である。

【請求項2】前記第1レンズ群は、逆望遠系のパワー配 置であることを特徴とする請求項1記載の投影光学系。

【請求項3】以下の条件を満足する、請求項1又は2記 載の投影光学系。

$$/\Sigma P_{3} < -0.2$$
 (7)

0. $6 < f_6 / f_4 < 1.$ 3 (6)

但し、L:前記レチクルからウエハまでの距離

E_n:最もレチクル側のレンズ面の頂点から入射瞳まで の距離

 E_x :最もウエハ側のレンズ面の頂点から射出瞳までの 距離

β:投影光学系の投影倍率

f₁:前記第1レンズ群の焦点距離

 $\mathbf{b} \mathbf{f}_1$: 前記第 1 レンズ群の最もウエハ側のレンズ面の 頂点から第1レンズ群の後側焦点までの距離

f₃:前記第3レンズ群の焦点距離

f₄:前記第4レンズ群の焦点距離

f₅:前記第5レンズ群の焦点距離

f₆:前記第6レンズ群の焦点距離 である。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は第1物体上のパター ンを第2物体としての基板等に投影するための投影光学 系に関するものであり、特に、第1物体としてレチクル (マスク) 上に形成された半導体用または液晶用のパタ ーンを、第2物体としての基板(ウエハ、プレート等) 上に投影露光するのに好適な投影光学系に係わるもので ある。

[0002]

【従来の技術】近年、IC、LSI等の集積回路パター ン転写には、主に縮小投影露光装置が用いられている。 この装置に用いられる投影光学系には、昨今の集積回路 の高集積化に伴い、広い露光領域と、その露光領域全体 にわたってのより高い解像力が要求されている。投影光 学系の解像力の向上については、露光波長をより短くす るか、あるいは投影光学系の開口数 (NA)を大きくす ることが考えられる。露光波長の短波長化に関しては、現在光源として主に使われている水銀ランプの紫外域スペクトルの g線 (436 n m) や i線 (365 n m) に代わつて、次世代に向けてKrFxキシマレーザー (248 n m) やArFxキシマレーザー (193 n m) などが注目されている。そして、以上の各種の露光波長の光によって、レチクル上のパターンをウエハ上に投影露光するための投影光学系が提案されている。

【0003】広い露光領域を達成するためには、投影光学系に起因する像面湾曲の補正が欠かせず、その必要条件としてペッツバール和を十分に小さくしなければならない。しかし、現実的な露光装置全体の大きさの制約などから、投影光学系の全長(物像間距離)が制限されるので、解像力の向上に関するNAを大きくするとき、ペッツバール和の補正と広い露光領域全体でのコマ収差等の他の収差の補正との両立は容易ではない。

【0004】また、前記項目と共に像歪みの低減が重要である。ここでいう像歪みとは、投影光学系によるディストーション(歪曲収差)の他に、重ね合わせ露光時の投影倍率誤差を含む。投影倍率誤差を低減させるため、一般にこれらの投影光学系では、像面であるウエハの平坦度や回路バターン転写時のフォーカスエラーなど、独特方向の誤差に起因する投影倍率の変化を無視できるいわゆる像側をしていることが多い。しかしているに、射出瞳が実質的に無限遠にあるいわゆる像側をレセントリックな光学系としていることが多い。しかしては、射出できなくなってきており、物体側、像側の両側テレセントリックな光学系が提案されている。この例としては、特開昭63-118115号、特開平4-157412号、特開平5-173065号等のものがある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】以上の各特許公報にて提案された光学系の中には、物体側、像側の両側テレセントリックな投影光学系が開示されている。しかしながら、以上の各特許公報にて提案されている両側テレセントリック投影光学系では、解像力に寄与する開口数(NA)が十分には大きくなく、さらにはペッッバール和と他の収差の補正との両立が十分にはなされていなかった。本発明は以上の問題点に鑑みてなされたものであり、入射瞳と射出瞳をほぼ無限遠に位置させるいわゆるが、入射瞳と射出瞳をほぼ無限遠に位置させるいわぬる両側テレセントリックな光学系としながらも、広い露光範囲での像面平坦性を確保するためのベッツバール和の補正と、微細なパターンを高解像に転写するための大きいNAの光束に対する諸収差の良好な補正との両立を実現させることのできる高性能な投影光学系を提供することを課題としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の課題を達成するために、本発明に係わる投影光学系は、物体側より順に、

正のパワーの第1レンズ群、正のパワーの第2レンズ群、負のパワーの第3レンズ群、正のパワーの第4レンズ群、負のパワーの第5レンズ群、及び正のパワーの第6レンズ群を少なくとも有している。そして、

L:第1物体から第2物体までの距離(物像間距離)

 E_n : 最も第1物体側のレンズ面 (第1レンズ面) の頂点から入射瞳までの距離

 E_x : 最も第2物体側 (像側) のレンズ面 (最終レンズ面) の頂点から射出瞳までの距離

β:投影光学系の投影倍率

f₁:第1レンズ群の焦点距離

 $\mathbf{b} \ \mathbf{f}_1$: 第1レンズ群の最も第2物体側のレンズ面の頂点から第1レンズ群の後側(第2物体側)焦点までの距離

f₃:第3レンズ群の焦点距離

f₄:第4レンズ群の焦点距離

 f_5 :第5レンズ群の焦点距離

f₆:第6レンズ群の焦点距離

とするとき、

$$\mid \mathbf{E}_{\mathbf{n}} \mid > \mathbf{L} \tag{1}$$

$$\mid E_{x} \mid > \mid L / \beta \mid \tag{2}$$

1.
$$0 < b f_1 / f_1 < 1. 5$$
 (3)

0.
$$0.4 < |f_3/L| < 0.06$$
 (4)

0.
$$0.4 < |f_5/L| < 0.06$$

0.
$$6 < f_6 / f_4 < 1. 3.$$
 (6)

なる各条件を満足するように構成したものである。

(5)

【0007】本発明による投影光学系では、物体側、像側の両側をほぼテレセントリックな光学系とすることによって、物体面や像面のたわみなどの光軸方向のずれによる像歪みを無視できる量にする対策がとられている。よって、光軸方向のずれによる像歪みが無視できる程度の実質的なテレセントリックな光学系とするために、上記条件(1)と(2)を満足する必要がある。条件式

(1)は入射瞳位置を規定したものである。ここでいう入射瞳位置とは、絞りASよりも第1物体側に配置された光学系による絞りASの近軸領域における像位置を、光学系の第1物体側の第1レンズ面頂点より測った距離である。条件式(1)を満足しないと、第1物体面のたわみ等による像面上での像歪みが無視できなくなる。同様に条件式(2)は射出瞳位置を規定したものである。条件式(2)を満足しないと、像面であるウエハなどの第2物体の平坦度や、回路パターン転写時のフォーカスエラーなど、光軸方向の誤差による像面上での像歪みが無視できなくなる。

【0008】また、正のパワーの第1レンズ群は第1物体側をテレセントリックな光学系に維持すると共に、ペッツバール和を補正するために、上記条件(3)を満足しなければならない。条件式(3)は、ペッツバール和を良好に補正するために、第1レンズ群の逆望遠系パワー配置の程度を規定している。条件式(3)の下限を越

えると、第1レンズ群の後側主点が第1物体に近づき過ぎてしまい、第1物体に近い位置に適切な負のパワーを配置することができず、ペッツバール和を良好に補正することが困難となる。逆に条件式(3)の上限を越えると、ペッツバール和の補正には都合が良いが、第1物体に近い位置に配置された負のパワーが相対的に強くなり、近近い位置に配置された負のパワーが相対的に強くなり、でしまう。なお、下限値を1・03とし、上限値を1・40とすることにより、更に良い結果が得られる。【0009】また、第1レンズ群は、物体側から順に負のパワー、正のパワーとなる逆望遠系のパワー配置とすることが好ましい。このような逆望遠系のパワー配置とすることが好ましい。このような逆望遠系のパワー配置とすることが好ましい。このような方になり、高次収差の発生を抑えることができる。

【0010】第1レンズ群に引き続く正のパワーの第2レンズ群は、主にディストーションを補正している。具体的には、この正のパワーの第2レンズ群によって正のディストーションを発生させて、第1レンズ群の凹面と、負のパワーの第3レンズ群によって発生する負のディストーションとをバランス良く補正している。

【0011】負のパワーの第3レンズ群と負のパワーの第5レンズ群は、主にペッツバール和を補正している。ここで、上記条件(4)と(5)を満足すると、ペッツバール和と他諸収差の良好な補正との両立が可能となり、大きいNAの光学系を達成することができる。条件式(4)の上限を越えると、第3レンズ群の負のパワーが弱くなりすぎてしまい、ペッツバール和を良好に補正

$$-0.5 < (\Sigma P_1 + \Sigma P_2) / \Sigma P_3 < -0.2$$
 (7)

なる条件を満足することが好ましい。条件式(7)の下限を越えると、第2レンズ群によるペッツバール和の増大が、第1レンズ群と第3レンズ群に比較して相対的に無視できなくなる。この結果、第2レンズ群によるペツバール和の増大分を相殺するために、第5レンズ群で発生する負のパワーの負担が重くなり、第5レンズ群で発生するもに条件式(7)の上限を越えると、ペッツバール和ので発生する負のディストーションに比較しては問題ないが、第1レンズ群と第3レンズ群の凹面で発生する負のディストーションに比較して、第2レンズ群の凸面による効果が相対的に弱くなりすで発生が不十分となる。この結果、第1レンズ群と第3レンズ群で発生する負のディストーションを良好に補正するのが困難となってしまう。

【0014】なお、各レンズ面のペッツバール和への寄与 P_i とは、一般的に次式(a)で定義され、あるレンズ群の部分系ペッツバール和とは、そのレンズ群に属する各レンズの各レンズ面でのベッツバール和の寄与 P_i の和をとったものである。

$$P_i = (\frac{1}{n_{i-1}} - \frac{1}{n_i}) \frac{1}{r_i}$$
 (a)

することができない。逆に条件式(4)の下限を越えると、第3レンズ群の負のパワーが強くなりすぎてしまい、第3レンズ群で発生するコマ収差やディストーションを良好に補正できなくなってしまう。同様に条件式(5)の上限を越えると、第5レンズ群の負のパワーが弱くなりすぎてしまい、ペッツバール和を良好に補正することができない。逆に条件式(5)の下限を越えると、第5レンズ群の負のパワーが強くなりすぎてしまい、第5レンズ群で発生するサジタルコマブレアを良好に補正できなくなってしまう。

【0012】正のパワーの第4レンズ群と正のパワーの第6レンズ群は、負のパワーの第5レンズ群をそれらの間に配置して、ダブルガウス・タイプの変型を構成している。この構成をとることにより、ダブルガウスの特徴である対称性による収差相殺の長所を十分に活用することができる。上記条件(6)は、この対称性による良好な収差補正に適した第4レンズ群と第6レンズ群のパワーの比率を規定するものである。この条件式(6)の上限を越えても下限を越えても、対称性による収差相殺補正の適切な範囲から出てしまい、コマ収差やディストーションの良好な補正ができなくなってしまう。

【0013】本発明においては、

 Σ P_1 :第 1 レンズ群のペッツバール和 Σ P_2 :第 2 レンズ群のペッツバール和 Σ P_3 :第 3 レンズ群のペッツバール和 とするとき、

ここで、 \mathbf{r}_i は第 \mathbf{i} レンズ面の曲率半径、 \mathbf{n}_i は第 \mathbf{i} レンズ面に続く媒質の屈折率を意味し、また、 \mathbf{r}_i が ∞ 即ち平面のとき、 \mathbf{P}_i は $\mathbf{0}$ となる。

【0015】本発明においてはまた、

 f_2 :第2レンズ群の焦点距離とするとき、

0.
$$1.4 < f_2/L < 0.25$$
 (8)

なる条件を満足することが好ましい。条件式(8)の上限を越えると、第2レンズ群の正のパワーが弱くなりすぎてしまい、ディストーションを良好に補正することが困難となる。逆に条件式(8)の下限を越えると、第2レンズ群の正のパワーが強くなりすぎてしまい、ペッツバール和を増大させると共に、高次のディストーションの発生が顕著になる。

【0016】本発明においてはまた、第3レンズ群と第5レンズ群とに属する各レンズの各レンズ而のパワーを めとするとき、何れのレンズ面についても、

$$|\phi \cdot L| < 6.7 \tag{9}$$

なる条件を満足することが好ましい。条件式(9)の範囲を越えて何れかのレンズ面のパワーが強くなりすぎてしまうと、高次収差の発生が顕著になり、他のレンズ群で補正するのが困難となる。

[0017]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を説明する。 以下の各実施例は、本発明による投影光学系を露光装置 に応用したものである。まず露光装置の全体構成を図1 によって説明する。投影光学系PLの物体面には、所定 の回路パターンが形成された投影原版としてのレチクル R (第1物体) が配置されており、投影光学系PLの像 面には、基板としてのウエハW(第2物体)が配置され ている。レチクルRはレチクルステージRSに保持さ れ、ウエハWはウエハステージWSに保持されている。 レチクルRの上方には、ケーラー照明法によってレチク ルRを均一に照明する照明光学装置ISが配置されてお り、また投影光学系PLは物体側にテレセントリックに 構成されている。したがって投影光学系PLの開口絞り ASの位置には、照明光学装置IS中の光源の像が形成 される。そしてレチクルRのパターン像が、投影光学系 PLによりウエハW上に露光(転写)される。いずれの 実施例も、照明光学装置IS内部に配置される光源とし て、193.4nmの露光波長入を持つ光を供給するエ キシマレーザを使用している。

【0018】図2~図6は、本発明による投影光学系の第1~第5 実施例のレンズ構成図を示している。図2~図6に示す如く、各実施例の投影光学系は、第1物体としてのレチクルR側より順に、正のパワーの第1レンズ群 G_1 と、正のパワーの第2レンズ群 G_2 と、負のパワーの第3レンズ群 G_3 と、正のパワーの第4レンズ群 G_4 と、負のパワーの第5レンズ群 G_5 と、正のパワーの第6レンズ群 G_6 とを有し、物体側(レチクルR側)及び像側(ウエハW側)においてほぼテレセントリックとなっており、縮小倍率を有するものである。またいずれの実施例の投影光学系も、像側のNAが0.6、投影倍率 β が1/4である。ウエハW上での露光領域の直径は、第1実施例と第2実施例では26.8であり、第3~第5実施例では30.6である。

【0019】次に図2に示す第1実施例の具体的なレンス構成について説明する。第1レンズ群 G_1 は物体側より順に、1枚の両凹レンズ L_{11} と2枚の凸レンズ L_{12} 、 L_{13} を配置することによって、逆望遠系を構成している。ここでは L_{11} を両凹レンズとすることで、負のパワーを2面に分担させて負のディストーションの発生を抑え、しかも負のパワーを十分に強くして、良好にペッツバール和を補正している。

【0020】第2レンズ群 G_2 は物体側より順に、1枚の凸レンズ L_{21} と、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{22} と、凸レンズ L_{23} の3枚によって構成されている。物体高によって光束の通る部分がより異なる凸レンズ L_{21} によって、ディストーションを効果的に補正すると共に、メニスカスレンズ L_{22} の像側に向けた凹面によって条件式(7)を満足するように構成し、こうして第2レンズ群 G_2 でのペッツバール和の増大を抑えてい

る。

【0021】第3レンズ群 G_3 は物体側より順に、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{31} 、両凹レンズ L_{32} 、そして物体側に凹面を向けた平凹レンズ L_{33} の3枚のレンズによりて構成されている。本第1実施例のように、ペッツバール和の補正に必要な負のパワーを少なくとも4面に分担させることが、コマ収差の発生を他のレンズ群で補正可能な量に抑えるのに好ましい。

【0022】第4レンズ群 G_4 は物体側より順に、凸レンズ L_{41} 、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{42} 、そして4枚の凸レンズ L_{43} 、 L_{44} 、 L_{45} 、 L_{46} によって構成されている。負メニスカスレンズ L_{42} の物体側に向けた凹面は、第2レンズ群 G_2 の L_{22} の機能と同様にペッツバール和の増大を抑えており、こうして第3レンズ群 G_3 と第5レンズ群 G_5 でのペッツバール和補正の負担を軽減して、過度のサジタルコマフレア等の発生を防いでいる。

【0023】第5レンズ群G5は物体側より順に、像側 に凹面を向けた平凹レンズL₅₁、像側に凹面を向けた負 メニスカスレンズL52、両凹レンズL53、そして物体側 に凹面を向けた負メニスカスレンズL54の4枚の凹レン ズによって構成されている。なお、本第1実施例では、 第5レンズ群G₅内の凹レンズL₅₃とL₅₄の間に開口絞 りASを配置している。ここで凹レンズL51の像側に向 けた凹面と凹レンズ L_{54} の物体側に向けた凹面は、互い に絞りASに関して対称な向きに配置されており、こう して非点収差の発生を抑制している。しかしそれだけで は負のパワーを強くしたとき、ダブルガウス・タイプに 付随する問題点であるサジタルコマフレアが十分に補正 しきれない。そこで本第1実施例では、凹レンズL51と L_{54} の向かい合う凹面の間に2枚の凹レンズ L_{52} 、 L_{53} を挿入することによって、各凹面に負のパワーを分担さ せ、サジタルコマ収差の発生を抑え、なお且つペッツバ ール和を良好に補正して像面湾曲の平坦性を確保してい

【0024】第6レンズ群 G_6 は物体側より順に、3枚の凸レンズ L_{61} 、 L_{62} 、 L_{63} と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{64} と、3枚の凸レンズ L_{65} 、 L_{66} 、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{69} 、 L_{610} との都合 10 枚のレンズによって構成されている。凹レンズ L_{64} は光束が大きく広がったところに配置され、物体側に凹面を向けたメニスカス形状とすることで、効率よく球面収差を前正している。また、凸レンズに関しては、NA0.60 光束に対して高次の球面収差やコマ収差の発生をできるだけ抑えるように、正のパワーを多数のレンズ間ののパワーを8枚の正レンズと2枚の負レンズで構成しているが、第6レンズ群 G_6 のパワーを8枚の正レンズと2枚の負レンズで構成しているが、第6レンズ群 G_6 は少なくとも6枚の正レンズを有することが、球面収差補正上好ましい。また、凹レンズ

L₆₈では、像側に向けた凹面によってディストーション の補正とコマ収差の補正との良好なバランスを可能とし ている。

【0025】次に、図3に示す第2実施例の具体的なレンズ構成は、第1実施例と類似するが、第1レンズ群 G_1 が物体側より順に、凸レンズ L_{11} と凹レンズ L_{12} 、そして2枚の凸レンズ L_{13} 、 L_{14} の4枚のレンズから構成されている点で異なる。凸レンズ L_{11} と凹レンズ L_{12} では、ペッツバール和の補正を維持しつつ、高次のディストーション補正と全露光領域にわたるテレセントリック性との良好なバランスに寄与している。

【0026】図4に示す第3実施例の具体的なレンズ構成は、第1実施例と類似するが、第1レンズ群 G_1 が物体側より順に、像側に凸面を向けたメニスカス正レンズ L_{11} と凸レンズ L_{12} との2枚の凸レンズから構成されている点が異なる。このように第1レンズ群 G_1 の逆望遠系を構成する際に、負レンズを含まなくてもよい。すなわち物体側に向けた凹面とある程度厚いレンズ厚を持つ正メニスカスレンズ L_{11} を利用することで、条件式

(3)を満たすことができ、この結果ペッツバール和を良好に補正することができる。また第6レンズ群 G_6 中の物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{69} との間に、4枚の凸レンズ L_{65} 、 L_{66} 、 L_{67} 、 L_{68} を有する。すなわち先の第1実施例では、この部分に3枚の凸レンズ L_{55} 、 L_{66} 、 L_{67} を配置していたが、球面収差とコマ収差を良好に補正するためには、この部分に少なくとも3枚以上の凸レンズを配置することが好ましい。この第3実施例では4枚の凸レンズを配置することにより、より良好に球面収差とコマ収差を補正している。

【0027】図5に示す第4実施例の具体的なレンズ構成は、第3実施例と類似するが、第4レンズ群 G_4 の凸レンズ L_{41} と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ L_{42} との間の距離の点で、主に異なる。この L_{41} と L_{42} との間隔の影響で、第4実施例では高次収差補正のバランスが他の実施例と多少異なるが、他の実施例とほぼ同様の機能を達成している。

【0028】図6に示す第5実施例の具体的なレンズ構成は、第3実施例に類似するが、第1レンズ群 G_1 が物体側より順に、1 枚の両凹レンズ L_{11} と2 枚の凸レンズ L_{12} 、 L_{13} と0 3 枚から構成される点で主に異なる。第1レンズ群 G_1 を負レンズ L_{11} を含む3 枚の構成にすることによって、ペッツバール和をより積極的に補正している。また第6レンズ群 G_6 において、物体側に凹面を向けた凹レンズ L_{64} と像側に向けた凹面を持つ凹レンズ L_{69} の間に、第3 実施例と同様に4 枚の凸レンズ L_{65} 、 L_{66} 、 L_{67} 、 L_{58} を配置しているので、広い画角に対してもコマ収差の補正が可能となっている。よって広い露光領域においても像面湾曲、球面収差、コマ収差等を良好にバランス良く補正している。

 $S i O_2$: n = 1.56019 $C a F_2$: n = 1.50138である。

【0030】また以下の表6に、各実施例について、前記各条件式に関連する諸値を掲げる。同表中、(7)欄の [Σ] は、条件式(7)の (Σ P₁+ Σ P₂) / Σ P₃を意味する。また(9)欄中、Sは第3レンズ群 G_3 と第5レンズ群 G_5 中で最大のパワーゆを有するレンズ面の番号、 \mathbf{r}_{\min} はそのレンズ面の曲率半径、 \mathbf{n} はそのレンズ面を有するレンズの屈折率、 \mathbf{r}_{\min} はそのレンズ面を有するレンズの屈折率、 \mathbf{r}_{\min} はそのレンズ面を有するレンズの屈折率、 \mathbf{r}_{\min} 0、第 \mathbf{r}_{\min} 1、 \mathbf{r}_{\min} 2、第 \mathbf{r}_{\min} 3、 \mathbf{r}_{\min} 3、 \mathbf{r}_{\min} 3、 \mathbf{r}_{\min} 3、 \mathbf{r}_{\min} 4、 \mathbf{r}_{\min} 5、 \mathbf{r}_{\min} 6、 \mathbf{r}_{\min} 6、 \mathbf{r}_{\min} 7、 \mathbf{r}_{\min} 8、 \mathbf{r}_{\min} 8、 \mathbf{r}_{\min} 9、 \mathbf{r}_{\min} 9、

[0031]

【表1】

	r	d			42	-3000. 00000	24.400000	S i O ₂	G_6
0	(レチクル)	103. 390978			43	-350. 29744	1.000000		
1	-45 3. 18731	17.000000	S i O ₂	G_{1}	44	362, 38815	46. 500000	CaF2	G_6
2	370. 52697	13.613089			45	-361. 31567	10.870000		
3	710. 84358	26.000000	SiO2	G_1	46	-251. 97148	23.000000	SiO2	$G_{\mathfrak{g}}$
4	-350. 78200	1.000000			47	-662. 28158	1.000000		
5	367. 53957	28. 000000	SiO2	G_1	48	238. 98700	38. 100000	CaF ₂	G_6
					49	1994. 63265	1.000000		
6	-567.47540	1.000000			50	211. 51173	33. 400000	CaF2	G_6
7	289. 50734	29. 000000	S i O ₂	G ₂	51	720.00000	1.000000		
8	-899.09021	1.000000			52	129. 92966	46.000000	CaF2	G_6
9	199.45895	23.000000	SiO2	G_2	53	669. 85166	2. 783304		
10	103.61200	15. 764153			54	970. 74182	19.986222	S i O ₂	G_{ϵ}
11	188. 56105	25. 800000	S i O ₂	G ₂	55	78. 20244	6. 273142		
12	-574. 20881	4. 212446			56	86. 12755	32. 522737	SiO2	G_6
13	3000.00000	16.616840	S 1 O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$	57	230.00000	2.862480		
14	118. 18165	21. 762847			58	232. 22064	44. 183443	S i O ₂	G_{ϵ}
15	-336. 11504	15. 000000	S i O ₂	G_3	59	350.03691	19. 466219		
16	161. 39927	25. 871656			60	(ウエハ)			
17	-120.57109	15.000000	S 1 O ₂	$G_{\mathfrak{z}}$	[003	3.2]			
18	∞	33.995810			【表2】				
19	-2985. 44349	36. 979230	S i O ₂	G_4					
20	-150. 10550	11.683590							
21	-122. 25791	28. 000000	S i O ₂	G_4					
22	-204.99200	1.000000							
23	∞	29. 240000	S i O ₂	G_4					
24	-312. 57215	1. 000000							
25	965. 45342	27. 000000	S i O ₂	G₄					
26	-643. 40298	1. 000000							
27	258. 67450	39. 000000	CaF ₂	G_4					
28	-2967. 14698	1. 000000							
29	246. 35328	35. 600000	CaF ₂	G ₄					
30	-2970. 04481	1.000000							
31	∞	24. 000000	S i O ₂	G_{5}					
32	157. 6317 1	10. 667015							
33	234. 15227	17. 000000	S i O ₂	G_{5}					
34	157.66180	32. 592494				,			
05	000 70400	15 000000	0 1 0	~					
35	-200. 72428	15. 000000	S i O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$					
36	432.89447	37. 939196							
37	(開口絞り)	24. 400000	0.10						
38	-175.71116	17.000000	SiO ₂	G₅					
39	-2985. 98357	1. 000000		_					
40	-2985. 99700	35. 500000	CaF ₂	G_6					
41	-189. 63629	1.000000							

	r	d			43	-188.48712	1.000000		
0	- (レチクル)	80. 005623			44	-3000. 00000	24. 400000	SiO ₂	G ₆
. 1	3000.00000	17. 000000	S i O ₂	G_1	45	-353. 86205	1. 000000		-0
2	-1100.07662	7. 000000			46	361.05640	46.500000	CaF2	G_6
3	-382. 34142	17.000000	S 1 O ₂	G_1	47	-362.74962	10. 870000	-	. •
4	370. 98157	19.096933			48	-252. 13935	23. 000000	S i O ₂	G۴
5	741, 43231	26.000000	SiO2	G_1	49	-639.45695	1.000000		
6	-346. 96815	1.000000			50	247. 94411	38. 100000	CaF2	G_6
7	378. 55115	28. 000000	SIO2	G_1	51	2772. 28294	1. 000000		
8	-618. 11456	1.000000			52	215.80752	33. 400000	CaF ₂	$G_{\mathfrak{b}}$
9	291. 02156	29.000000	S i O ₂	G2	53	741. 95006	1.000000		
10	-960. 02967	1.000000			54	129.48833	46.000000	CaF2	G_6
11	213. 50227	23. 000000	S 1 O ₂	G_2	55	603.00127	2.812610		
12	102.07483	15. 012850			56	838.71234	21.000000	S i O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$
13	181. 74774	25. 800000	S i O ₂	G ₂	57	78. 85022	5. 688924		
14	-533. 56895	1.000000							
15	2712. 39289	16.616840	SiO2	G_3	58	86.96257	33. 318579	SIO2	G_6
16	121.06433	20. 547736			59	230.00000	1. 975770		
17	-296. 23495	15.000000	SiO2	G_3	60	232. 95189	44. 943637	S i O ₂	G_6
18	161. 25942	25. 185487			61	350. 55917	19.466219		
19	-118. 38102	15. 000000	S I O ₂	G_3	62	(ウエハ)			
20	∞	33. 572517			. [00	3 3]			
21	-2884. 98321	36. 979230	S i O ₂	G ₄	【表3】	1			
22	-146. 43548	11. 683590							
23	-120.69431	28. 000000	$S i O_2$	G_4	•				
24	-204 . 17381	1.000000							
25	∞	29. 240000	S i O ₂	G₄		•			
26	-312. 30286	1.000000		_					
27	903. 22838	27. 000000	S i O ₂	G_4					
28	-665. 9795 1	1. 000000							
29	260, 25775	39. 000000	CaF ₂	G ₄					
30	-2965. 88489	1. 000000	Cary	U ,					
31	239. 96625	35, 600000	CaF ₂	G.					
32	-3000.00000	1. 000000	Our,	04			•		
33	∞	24. 000000	S i O ₂	G ₅					
34	153.46592	10. 823731		-5					
35	231. 12502	17. 000000	S i O ₂	G_5					
36	157. 10450	32, 398005		•					
37	-195. 18116	15.000000	S i O ₂	G₅					
38	443. 35877	37.069128	-	-					
39	(開口絞り)	24. 400000							
40	-175. 99683	17.000000	S i O ₂	G_{5}					
41	-2899. 97402	1.000000							
42	-2966. 55706	35. 500000	CaF ₂	G_6					

	r	d			43	-327. 35127	9. 017132		
0	(レチクル)	87. 842324			44	-229. 80012	21.000000	SiO2	G_6
1	-351. 29858	74. 258738	S i O ₂	G_1	45	-1820. 23082	0.500000		
2	-298. 15798	0. 500000			46	535. 39152	26. 000000	CaF2	G_6
3	553. 95876	25. 000000	SiO2	G_{1}	47	-988. 48090	0.500000		
4	-617. 71850	0.500000			48	327. 47057	27. 500000	SiO2	G_6
5	253.09163	25. 500000	SiO2	G_2	49	4987. 19075	0. 500000		
6	-3777. 3305 6	0.500000							
7	190. 14717	27. 805896	S i O ₂	G_2	50	253. 24680	27.500000	CaF2	G_{6}
8	105. 42692	15. 912587			51	1316, 11991	0.500000		
9	201.82417	20.000000	S i O ₂	G_2	52	132. 63747	42. 963984	CaF2	G_6
10	-584. 55642	0.500000			53	629. 46057	1.800000		
11	3000.00000	19.095104	S I O ₂	G_3	54	868. 98502	35. 719214	SiO2	G_{6}
12	105. 34607	23. 338460			55	80. 85953	6. 365035		
13	-337. 23699	15. 382167	S i O ₂	G_3	56	88. 09767	39. 251047	CaF ₂	G_6
14	248.69492	21. 216782			57	355. 00000	0.530420		
15	-133.88017	15. 448042	SiO2	G_3	58 ⁻	351.07133	45. 922298	S i O ₂	G_{ϵ}
16	2973. 13758	47. 591478			59	436.07534	14. 155299		
17	-5000.00000	26. 416153	SiO2	G_4	60	(ウエハ)			
18	-169. 85758	13.500000			[003	3 4]			
19	-125. 21057	33.670949	S i O ₂	G_4	【表4】				
20	-220.03085	0.500000							
		•							
21	∞	26. 520978	SiO2	G_4					
22	-325. 33259	0.500000							
23	736. 93850	29.000000	SiO2	G_4					
24	-5 60. 6 4661	0.500000							
25	366.01277	28.000000	S i O ₂	G_4					
26	-3481.04946	0.500000							
27	242, 17825	45. 121070	CaF2	G_4					
28	-5000.00000	0.500000							
29	∞	34.715089	S i O ₂	G_{δ}					
30	152, 12354	11.669230							
31	237. 82697	16. 443006	S i O ₂	G_{5}					
32	154. 91919	38. 109146							
33	-185. 64902	14. 321328	S 1 O ₂	G_{δ}					
34	559. 07808	26. 892063							
35	(開口絞り)	21. 952360							
36	-147. 25357	17.830696	S i O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$		•			
37	∞	0.500000							
38	5000.00000	32.000000	CaF ₂	G_{ϵ}					
39	-170. 72868	0. 500000							
40	-930. 41140	21. 000000	S i O ₂	G_6					
41	-289.67853	0.500000			•				
42	403. 38962	38. 720628	CaF ₂	$G_{\mathfrak{s}}$					

	r	d			43	-378. 84873	9. 985852		
0	(レチクル)	86. 313742							
1	-433. 57842	74, 258738	S i O ₂	G_1	44	-244. 09971	21.000000	SiO2	G_6
2	-331.50654	0. 500000			45	-2680. 44816	0.500000		
3	559.96288	25. 000000	S 1 O2	G_1	46	359. 48999	26.000000	CaF ₂	G_{6}
4	-583. 13377	0.500000			47	-5000. 00000	0.500000		
5	262. 88205	25. 500000	SiO2	G_2	48	391. 78229	27. 500000	SiO2	G ₆
6	-2712.40287	0.500000			49	-5000.00000	0.500000		
7	193.77173	26.000000	S 1 O ₂	G_2	50	248. 57500	27.500000	CaF ₂	G٥
8	107. 21122	12.619545			51	723. 23935	0.500000		
9	190. 85163	20.000000	S i O ₂	G2	52	123.06548	42. 963984	CaF ₂	G_6
10	-560. 78221	0.500000			53	568. 02920	1. 929341		
11	4482.98861	19.095104	SIO2	G_3	54	798. 40481	21. 145491	SiO2	G_{ϵ}
12	109. 25270	19.036007			55	80. 88243	6. 365035		
13	-562. 52015	15. 382167	S i O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$	56	89. 63627	39. 251047	CaF2	G_6
14	184.00884	23. 167680			57	-3000.00000	0.530420		
					58	-4944. 71373	46.500000	S i O ₂	G_{6}
15	-117.90615	15. 448042	S i O ₂	G_3	59	442. 15484	18. 732427		
16	5000.00000	48. 718404			60	(ウエハ)			
17	-5000.00000	26. 416153	S i O ₂	G ₄	[00]	35]			
18	-165. 73836	31. 081545			【表 5 】	!	•		
19	-124. 20414	31. 565534	S i O ₂	G_4					
20	-203.09274	0.500000							
21	-4915. 5 250 5	26. 520978	SiO2	G_4	•				
22	-321.56546	0.500000							
23	509.82729	29.000000	S i O ₂	G_4					
24	-906. 29678	0.500000							
25	360.83202	28. 000000	S i O ₂	G_4					
26	-2069. 90140	0.500000							
27	246, 84252	32. 884285	CaF2	G_4					
28	-3200.00000	0.500000							
29	-4980.80583	46. 093480	S I O ₂	$G_{\mathfrak{s}}$					
30	148.03902	11.669230							
31	234.61256	16. 443006	S i O ₂	G_{5}					
32	153.45418	3 1. 004339							
33	-188. 95798	14. 321328	S i O ₂	G_{δ}					
34	500.84049	26. 892063							
35	(開口絞り)	18. 228745							
36	-167. 99189	30. 216688	S i O ₂	G_5					
37	5000.00000	0. 500000	_						
38	3130.64989	32. 000000	CaF ₂	G_6					
39	-188. 11418	0. 500000							
40	-1898. 83868	21. 000000	S i O ₂	G_6					
41	-330. 33425	0. 500000							
42	336.89888	38. 720628	CaF ₂	$G_{\mathfrak{s}}$					

		,			40	1000 51015	01 000000	SiO2	G_{ϵ}
	r	d			42	-1290. 51915	21. 000000	3 1 02	Ge
0	(レチクル)	89. 938439	•••		43	-281, 02753	0. 500000	C - F	0
1	-278. 31968	24. 324989	S i O ₂	G_1	44	389. 15318	38, 720628	CaF ₂	G ₆
2	358. 97399	14. 000000		0	45	-363. 76526	10. 923296	010	<u></u>
3	630. 65888	32. 000000	S i O ₂	G ₁	46	-227. 45443	21. 000000	S i O ₂	$G_{\mathfrak{b}}$
4	-279. 63900	0. 500000		_	47	-1226. 77556	0. 500000		_
5	324.80109	30. 000000	S i O ₂	G_1	48	490.61591	26. 000000	CaF ₂	G_{ϵ}
6	-569.64601	0.500000			49	-1451.02767	0. 500000		
7	254. 51115	30. 000000	S I O ₂	G_3	50	342. 24280	27. 500000	S I O ₂	G_{6}
8	-2773. 53473	0. 500000			51	œ	0. 500000		
					52	245. 62492	27. 500000	CaF ₂	G_6
9	188.08534	26.000000	S i O ₂	G ₂	53	1282.50070	0. 500000		
10	98. 24738	16. 726944			54	134. 57766	42. 963984	CaF ₂	G_6
11	192, 49488	23.000000	SiO2	G_2	55	635. 87829	3. 137255		
12	-556. 35255	0.500000			56	951. 66806	33. 023520	S i O ₂	G_6
13	4619.33310	19.095104	S i O ₂	G_3	57	83.44325	6, 365035		
14	116.41300	18. 338460			58	91. 79955	39. 251047	CaF2	G_6
15	-1099. 49346	15. 382167	S i O ₂	G_3	59	355.00000	0. 530420		•
16	190.51069	26. 216782			60	341.48270	46. 500000	S i O ₂	G_6
17	-132. 37738	15. 448042	SiO2	G_{3}	61	465. 17186	14. 155299		
18	1189.93256	57. 729814			62	(ウエハ)			
19	-5000.00000	26. 416153	S i O ₂	G ₄	[003	6]			
20	-203.62120	17.048271			【表6】				
21	-123. 56550	26. 327345	S i O ₂	G ₄					
22	-204. 21523	0.500000							
23	œ	26. 520978	SiO2	G ₄					
24	-345. 79464	0.500000							
25	584.04620	29.000000	SiO2	G ₄				*	
26	-602.24304	0.500000							
27	421.56019	28. 000000	S i O ₂	G_4					
28	-1123. 34423	0. 500000							
29	246. 29006	41. 457735	CaF2	G ₄					
30	-5000.00000	0. 500000							
31	∞	31. 780371	S i O ₂	G_5					
32	159, 19296	11.669230							
33	281.83842	16.443006	SiO2	G ₅					
34	175. 89651	28. 590762							
35	-193.86521	14. 321328	S i O ₂	G_5					
36	373. 19656	26. 892063							
37	(開口絞り)	20. 226657							
38	-151.07311	18. 537276	SiO2	G ₅					
39	00	0.500000							
40	5000.00000	32.000000	CaF2	G ₆					
41	-182. 33571	0.500000	- -	-					
					•				
		実施例番号	1	2	3	4	5		
	(:	1) E _n	4040.2	4143.5	3221.0	3098.6	3315.9		
		L	1200	1200	1200	1200	1200		
	(:	2)E _x -	19785.5	-21729.2	-16530.8	-16521.4	-17323.4		
	,								

β	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
L / ß	4800	4800	4800	4800	4800
$(3) b f_{1}$	425.457	374.783	426.000	404.945	415.223
\mathbf{f}_1	402.204	361.596	405.169	390.801	375.243
$b f_1/f_1$	1.058	1.036	1.051	1.036	1.107
(4) f_3	-58.747	-58.282	-63.470	-61.333	-66.475
f ₃ /L	0.049	0.049	0.053	0.051	0.055
$(5) f_5$	-64.565	-63.925	-58.541	-60.395	-60.039
f ₅ /L	0.054	0.053	0.049	0.050	0.050
$(6) f_4$	123.634	122.810	128.251	131.647	131.280
\mathtt{f}_{6}	109.563	108.867	103.822	106.137	105.207
f_6/f_4	0.886	0.886	0.810	0.806	0.801
(7) $[\Sigma]$	-0.422	-0.431	-0.442	-0.453	-0.357
$(8) f_2$	258.588	266.756	266.822	255.282	275.357
f_2/L	0.215	0.222	0.222	0.213	0.229
(9)S	14	19	8	12	14
r _{min}	118.18165	-118.38102	105.42692	109.25270	116.41300
n	1.56019	1.56019	1.56019	1.56019	1.56019
$ \phi \cdot L $					
回 1 1) これか	わな1 _ なこ	cir th:	一世 一世 1、10年 年	が回ったのはこ	ガザ 担み へかだ

【0037】図7~図11に、それぞれ第1~第5実施例の球面収差、非点収差、歪曲収差、及び横収差を示す。各収差図において、NAは投影光学系の開口数、Yは像高を示す。また、非点収差図中、破線はメリジオナル像面、実線はサジタル像面を示す。各収差図より明らかなように、各実施例とも、所要のレンズ構成を取り、且つ前記各条件式を満たすことにより、良好な結像性能を有することが分かる。

【0038】なお、以上の各実施例では、193.4nmの光を供給するエキシマレーザを露光光源として用いた例を示したが、本発明はこれらの光源に限られることなく、248.4nmの光を供給するエキシマレーザ等の極紫外光源や、g線(436nm)、i線(365nm)の光を供給する水銀アークランプ、さらにはそれ以外の紫外領域の光を供給する光源を用いたものにはそれ以外の紫外領域の光を供給する光源を用いたものには同し得る。また、本実施例では露光波長のスペクトル幅が単色とみなせない場合での色収差補正を施す2種類の光学材料を用いたレンズ構成を示したが、エキシマレーザの発振波長の狭帯域化の技術が向上すれば、低コスト化の可能な単一光学材料で構成してもよいし、逆に複数種の光学材料を組み合わせて、より広いスペクトル幅の色収差を補正してスループットの向上を図ってもよい。

[0039]

【発明の効果】以上のように、本発明による投影光学系によれば、両側テレセントリックな光学系としながら、諸収差がバランス良く補正され、しかも大きな開口数を待つ高解像な投影光学系が達成できる。特に、本発明の投影光学系では、ディストーションとベッツバール和が極めて良好に補正されている。従って本発明によれば、大きな開口数に対する高次のコマ収差等の補正のみなら

ず、広い露光範囲での像面平坦性の確保と像歪を非常に 低減する効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による投影光学系を適用する露光装置を 示す概略図である。

【図2】本発明による第1実施例のレンズ構成図である。

【図3】本発明による第2実施例のレンズ構成図であ ス

【図4】本発明による第3実施例のレンズ構成図である。

【図5】本発明による第4実施例のレンズ構成図であ る。

【図 6 】本発明による第 5 実施例のレンズ構成図である。

【図7】本発明による第1実施例の諸収差図である。

【図8】本発明による第2実施例の諸収差図である。

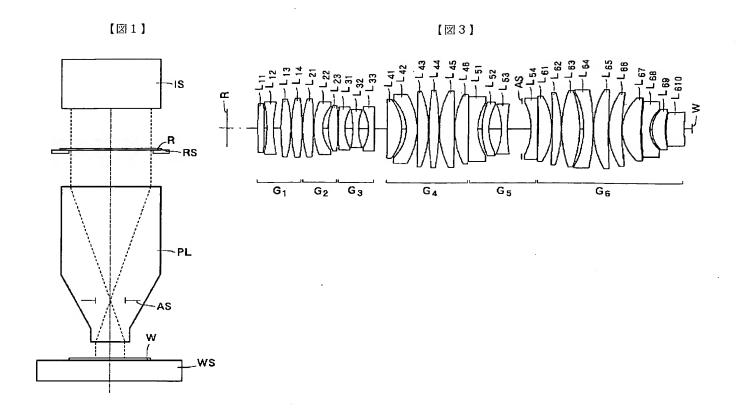
【図9】本発明による第3実施例の諸収差図である。

【図10】本発明による第4実施例の諸収差図である。

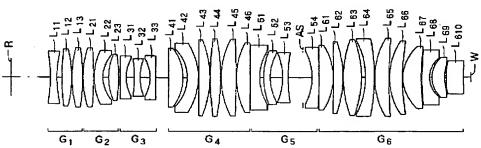
【図11】本発明による第5実施例の諸収差図である。

【符号の説明】

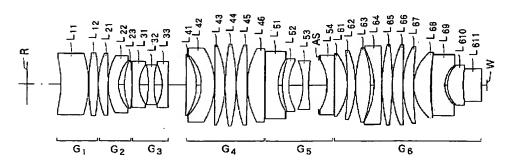
ズ



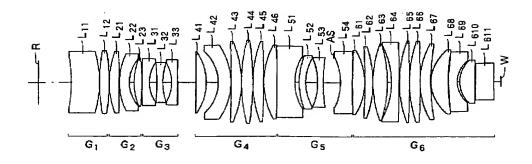




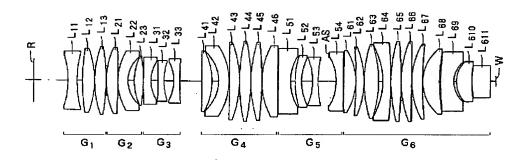
【図4】



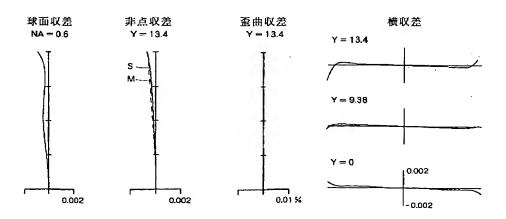
【図5】



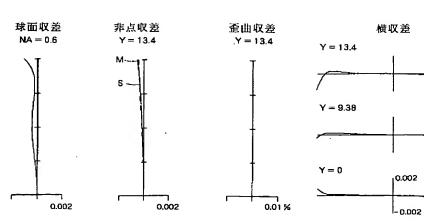
【図6】



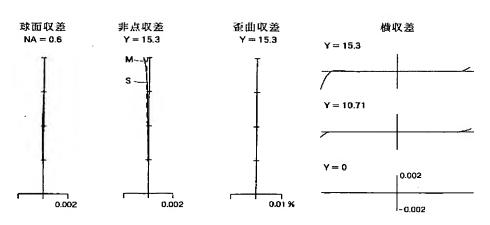
【図7】



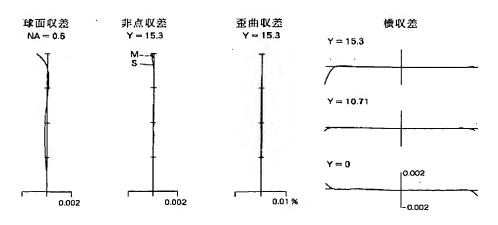
【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

